

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成30年11月15日(2018.11.15)

【公開番号】特開2017-116769(P2017-116769A)

【公開日】平成29年6月29日(2017.6.29)

【年通号数】公開・登録公報2017-024

【出願番号】特願2015-253117(P2015-253117)

【国際特許分類】

G 03 F 7/20 (2006.01)

G 01 B 11/00 (2006.01)

【F I】

G 03 F 7/20 5 2 1

G 03 F 7/20 5 0 1

G 01 B 11/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成30年10月1日(2018.10.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 1】

(第1実施形態)

図1は本発明の第1実施形態に係る検出装置を含む露光装置の概略図である。露光装置は、照明光学系3と、投影光学系4と、基板ステージ7とを備える。照明光学系3は、露光装置本体2に対して不図示のアライメント機構により位置合わせされた原版1を照明する。原版1は、例えば、露光されるべき微細なパターン(例えば回路パターン)が描画されたガラス製の原版である。基板ステージ7は、基板5を保持する基板保持部6を備え、投影光学系4の光軸(Z軸)に垂直なXY平面上を移動する。基板5は、例えば、ガラス基板である。原版1のパターンは、投影光学系4を介して基板5上の露光領域に転写される。基板ステージ7は、XY方向だけでなく、Z方向にも可動で、基板5と原版1の合焦のための駆動系ともなる。また、基板ステージ7上には、ミラー8が載置され、レーザ干涉計9を用いてX方向の駆動が制御されている。Y方向についても不図示であるが同様の構成がとられており、XY平面内での精密な駆動制御がなされている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 2-4】

